

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成30年11月15日 (2018.11.15)

【公開番号】特開2017-116769(P2017-116769A)
 【公開日】平成29年6月29日 (2017.6.29)
 【年通号数】公開・登録公報2017-024
 【出願番号】特願2015-253117(P2015-253117)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 1 B 11/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 3 F 7/20 5 0 1

G 0 1 B 11/00 B

【手続補正書】
 【提出日】平成30年10月1日 (2018.10.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 1 1 】

(第 1 実施形態)

図 1 は本発明の第 1 実施形態に係る検出装置を含む露光装置の概略図である。露光装置は、照明光学系 3 と、投影光学系 4 と、基板ステージ 7 とを備える。照明光学系 3 は、露光装置本体 2 に対して不図示のアライメント機構により位置合わせされた原版 1 を照明する。原版 1 は、例えば、露光されるべき微細なパターン（例えば回路パターン）が描画されたガラス製の原版である。基板ステージ 7 は、基板 5 を保持する基板保持部 6 を備え、投影光学系 4 の光軸（Z 軸）に垂直な X Y 平面上を移動する。基板 5 は、例えば、ガラス基板である。原版 1 のパターンは、投影光学系 4 を介して基板 5 上の露光領域に転写される。基板ステージ 7 は、X Y 方向だけでなく、Z 方向にも可動で、基板 5 と原版 1 の合焦のための駆動系ともなる。また、基板ステージ 7 上には、ミラー 8 が載置され、レザ干涉計 9 を用いて X 方向の駆動が制御されている。Y 方向についても不図示であるが同様の構成がとられており、X Y 平面内での精密な駆動制御がなされている。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】図面
 【補正対象項目名】図 2 4
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【 図 2 4 】

